## ⑩日本国特許庁(JP)

⑪特許出願公開

#### ⑫ 公 開 特 許 公 報 (A) 昭61 - 147534

@Int\_Cl\_4

識別記号

庁内整理番号

母公開 昭和61年(1986)7月5日

H 01 L 21/304 B 08 B 3/12 B 08 B 3/12

D-7376-5F Z - 6420 - 3B

審査請求 未請求 発明の数 1 (全5頁)

超音波化学処理方法 60発明の名称

> 昭59-268423 创特 願

昭59(1984)12月21日 ❷出 頤

土 橋 砂発 明 者

人

羲 和

調布市柴崎2丁目1番地3 調布市柴崎2丁目1番地3

島田理化工業株式会社内 島田理化工業株式会社内

明 73発 者

澄 潅 沢 島田理化工業株式会社

調布市柴崎2丁目1番地3

の出 顋 賢治 弁理士 元.橋 10代 理

外1名

1. 発明の名称 超音波化学処理方法

### 2. 特許請求の範囲

超音波振動するホーン中に処理液を流し、処 理液にキャビティションを付与し、この処理液 を被処理物に噴射して被処理物にキャビティシ ョンを伝達させるととを特徴とする超音放化学 処理方法。

### 3. 発明の詳細な説明

〔発明の目的〕

(産業上の利用分野)

本発明は超音波化学処理方法に関するもので ある。

#### (従来の技術)

例えば、処理手段が洗浄である場合、被処理 物の上からノメルにより加圧が体を吹きつけた り、プラシの回転により剝ぎとるように構成し ていた。

加圧液体による手段を具体的に説明すると、 第7図に示すように、支持策体ノの上面にケー ススを固定し、ケーススの底3に軸受具4を取 けて、断面T字形をした上面を支持面よとした 回転台6を垂直に貫通して回転自在に支持して いる。この回転台もは下面を支持筬体!の底ク に設置した支持台8の内面に螺合した支持具9 で支持している。との支持具タは真空ポンプ( 図示省略)に接続する真空用ホース/0を設け、 との真空用ホース / 0 に連通する通路 / / を設 けている。そして、前記回転台6の中央上面の 支持面よまで貫通した真空用通路/2を設けて 通路11と連通させ、支持面5に乗架した被処 理物/3を吸着保持する。又、回転台6はブー リノチを固定し、支持僚体/内に設置したモー タノなで駆動するブーリノるとブーリノチとに ベルトノクを掛けて回転できるようになつてい る。そして、回伝している被処理物!3上にノ ズル / 8 から加圧処理 放 / 9を噴射して洗浄、 エッチング、現像等の処理を行うようになつて いる。尚、図中20はドレーン抜きである。又 被処理物!3の上面にプラシを取付け洗浄する

方法もある。

又、ブラシで剝ぎとるその他の手段を第8回に基いて説明すると、コンペア-2/上を移動する被処理物/3の上下を回転するブラシ22 により剝ぎとるようになつている。

(発明が解決しようとする問題点)

前記従来の手段において加圧液体を受射するものは、被処理物に均等に処理液を噴射することが困難であり、ブラシを使用したものにおいては、処理むらがでたり、ブラシに付着した汚物により、被処理物に傷を付けたりする恐れがあつた。

# [発明の構成]

(問題点を解決するための手段)

本発明における超音波化学処理方法は、超音波振動するホーン中に処理板を流し、処理液にキャビティションを付与し、この処理液を被処理物に吸射して被処理物にキャビティションを伝達させるものである。

(作用)

部を省略する。

第1実施例においては、回転台6の支持面5 に被処理物/3を載置し、真空用通路/2で連 通する真空ポンプ(図示省略)で吸引して被処 理物 / 3を支持し、回転台 6を回転させる。そ して、シリンダ36によりホーン31を被処理 物/3に/w~/0mの間隔を有するように近 づけ、ホーン31の処理液通路32から処理液 を排出させ、被処理物/3の表面に処理液の膜 4/を形成せしめる。ホーン3/は6RHZ~ 100KHZの超音波振動をしているので、処 理 椎の 膜 4 / を介して 超音波 エネルギーを被処 理物/3に伝えることになる。又処理液にはホ - ン3/中を流れる際に超音波のキャビティン ョンが発生することになり、被処理物/3上に ある汚染物を糾離したり、現像やエッチングす る場合であれば化学反応がむらなく短時間に行

したがつて、シリコンウェハ - 、半導体用マスク等を超音波でエッチングや現像或いは洗浄

本発明においては、彼処理物の上に処理核の 膜を形成し、この膜に超音波提動するホーンを 接触させて、被処理物に超音波エネルギーを伝 達し、処理液に発生したキャピテイションによ り汚染物の洗浄、現像、エッチング等を行うも のである。

#### (実施例)

本発明の第/実施例を第/、2 図に示す装置の一例を用いて具体的に説明すると、被処理物/3の上方に超音波扱動子30により超音波扱動するホーン3/を位置させる。とりはエ字形の処理な通路3~2を設けてが3%を接続しいる。超に取るの上面に位を接てし、が3の上面に位を接てし、が37に固定を接続のロッド37に固定を設けてが36に取付た支持節材40に設けたボール39に取付た支持節材40に定している。

他は第7図と阿様なので同一符号を付し、一

、を行うのに適している。

又、リンサードライヤーに応用してリンサーの納水に超音波を当てながらリンスして乾燥することにより、より一層の精密乾燥を行うことができる。

次に、第2実施例を第3図乃至第5図に基いて説明すると、本実施例に用いるホーン3/は第3,4図に示すように、先端形状を矩形状に形成して複数個の排出ロ42,42,---を設け、一本の処理液通路32に分岐路43,--- 放用バイブ33を接続している。そしして、ホーン3/はホーン3/では撮動の節部44を設け、支持部材45に取付けている。

前記ホーン3/はローラコンベアー46上を移動する被処理物/3に近づけてセットし、第
/実施例と可様に排出ロ42,42,---か
6処理液を排出して被処理物/3上に処理液の

# 特開昭61-147534(3)

即41を形成せしめ、この際41を介して被処 理物!3に超音波エネルギーを伝達し、処理液 はホーン31中を成れる際に にキャピティションを発生させて各種の処理を 行う。

尚、第5凶中34社発振器、46はモータ47で駆動する領車で、ローラコンベアー46の 末端に設けた領車48を駆動するようになつている。

図、第3図は第2実施例に用いる装置のホーンのみを示す側面図、第4図はその正面図、第5図は処理状態を示す正面図、第6図は第3実施例の配置を示す正面図、第7図は従来の一例を示す断面図、第8図は他の例を示す正面図である。

尚、図中 / 3 ··· 被処理物、 3 / ···ホーン、 4 / ··· 処理務の膜である。

特許出願人 島田理化工業株式会社

代 理 人 元 橋 賢



樹 5 / においては、排出ロチ 2 , - - - から純水を吹付けてすすぎを行い、低る槽 5 2 においては純水にて更にすすぎを行い、低头槽においてはエアーナイフ 5 5 により液切りを行い低 5 槽 5 4 において熱風乾燥を行う。

尚、現像を行う際には、 M / 槽 5 0 にて現像 被を吹付け、 M 2 槽 5 / において処理 液を、 M 3. 槽 5 2 において純水を吹付ければよいもので ある。

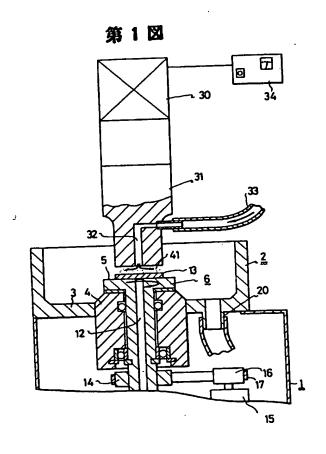
# 〔発明の効果〕

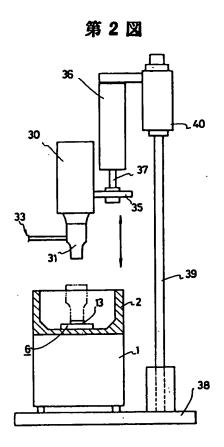
本発明においては、処理液を介して被処理物 に超音波エネルギーを伝達し、更に処理液にキャピティションを発生させるので、処理が破実 で且つ均一に行うことができる。

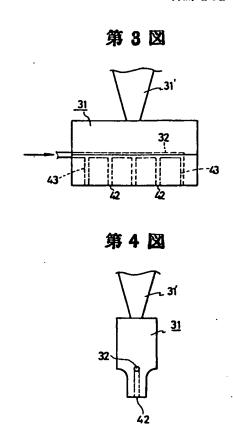
又、ホーン中に処理 蔽を流すので、ホーンの 冷却を行うことができる。

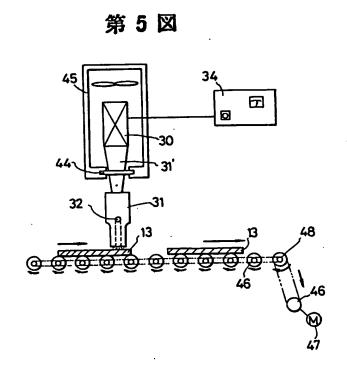
# 4.図面の簡単な説明

第/図は本発明に係る超音波化学処理方法の 第/実施例に用いる装置の要部を示す断面図、 第2図は全体の配置を示す一部を切欠いた正面

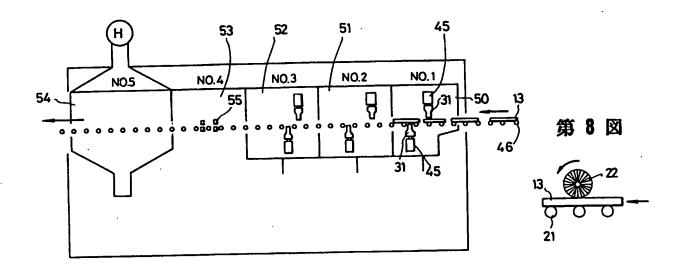


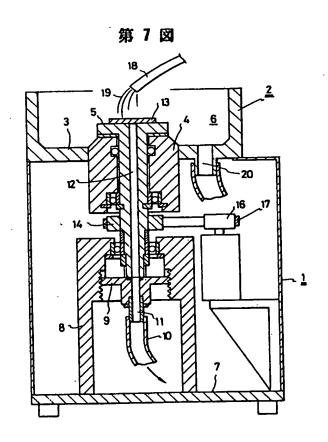






第6図





PAT-NO:

JP361147534A

DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 61147534 A

TITLE:

SUPERSONIC CHEMICAL TREATING METHOD

PUBN-DATE:

July 5, 1986

#### INVENTOR-INFORMATION:

NAME

COUNTRY

DOBASHI, YOSHIKAZU TAKIZAWA, SUMUTO

#### ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME

COUNTRY

SHIMADA PHYS & CHEM IND CO LTD N/A

APPL-NO: JP59268423

APPL-DATE: December 21, 1984

INT-CL (IPC): H01L021/304 , B08B003/12

US-CL-CURRENT: 257/E21.239

#### ABSTRACT:

PURPOSE: To effectively and uniformly treat by transmitting a supersonic energy to an article to be treated through a treating solution, and generating a cavita tion in the solution.

CONSTITUTION: Treating solution is exhausted from a treating solution passage 32 of a horn 31, and a solution film 41 is formed on the surface of an article 13 to be treated. Since the horn 31 vibrates in supersonic wave of 60100kHz, supersonic energy is transmitted through the film 41 to the article 13. A supersonic cavitation occurs in case of flowing the solution through the horn 31, chemical reaction is performed without irregularity in a short time in case of separating contaminants on the article 13 or developing or etching.

COPYRIGHT: (C) 1986, JPO&Japio

4/15/06, EAST Version: 2.0.3.0